

青岛福润德微电子有限公司 LPCVD设备

产品名称	青岛福润德微电子有限公司 LPCVD设备
公司名称	青岛福润德微电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区北万工业园
联系电话	13465806426

产品详情

满足半导体集成电路，电力电子器件，光电子等行业用于在硅片上淀积SiO₂、Si₃N₄、Poly-Si、磷硅玻璃、硼硅玻璃、非晶硅及难熔金属硅化物等多种薄膜工艺。CVD系统性能特点：

u结构形式：1—4管卧式热壁型

u硅片规格：2—8英寸硅片(或125 × 125mm、156 × 156mm方片)

u温度范围：300 ~ 1100

u恒温区长度及精度：200ram—1000mm(±1 / 24h)

u淀积薄膜均匀性：片内 ± 5% 片间 ± 5% 批间 ± 5%

u沉积膜厚度：600 ~ 15000A

u系统极限真空度：优于1Pa

u工作压力范围：20 ~ 133Pa闭环控制

u控制方式：工业微机

u送料装置：悬臂推拉舟、软着陆系统

u淀积薄膜分类：Si₃N₄、SiO₂、PSG、Poly-Si膜

u真空泵：罗茨泵、机械泵

u工艺气路：5路气/管。VCR接口

u40KHz脉宽调制AE高频电源

u装片量：200片/舟